

# DIN 50455-2:1999-11 (D)

## Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Verfahren zur Charakterisierung von Fotolacken - Teil 2: Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von Positiv-Fotolacken

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	.....	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Kurzbeschreibung des Verfahrens</b> .....	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Formelzeichen und Einheiten</b> .....	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Definitionen</b> .....	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>Geräte und Materialien</b> .....	<b>2</b>
<b>7</b>	<b>Durchführung</b> .....	<b>3</b>
<b>7.1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>3</b>
<b>7.2</b>	<b>Auftragung des Fotolackes</b> .....	<b>3</b>
<b>7.3</b>	<b>Belichtung</b> .....	<b>3</b>
<b>7.4</b>	<b>Entwicklung</b> .....	<b>3</b>
<b>8</b>	<b>Auswertung</b> .....	<b>3</b>
<b>9</b>	<b>Präzision des Verfahrens</b> .....	<b>3</b>
<b>10</b>	<b>Prüfbericht</b> .....	<b>4</b>